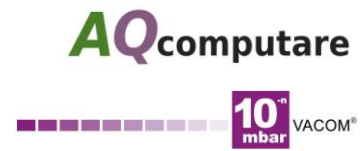




Industrie- und Handelskammer
Chemnitz



Erstes Industriegespräch Chemnitz/Jena im Technologie Centrum Chemnitz

Dienstag, den 24. Mai 2011 von 17.00 Uhr bis ca. 21.30 Uhr im Hörsaal Haus C,
Annaberger Straße 240, 09125 Chemnitz

Erstes Industriegespräch Chemnitz/Jena des Arbeitskreises für Industrie und Wirtschaft der DPG

Dieses erste Industriegespräch bietet ein regionales Forum für PhysikerInnen zu einem Thema der physikalischen Forschung sowie einen aktuellen Bezug zur Industrie an der Schnittstelle des Transfers wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Anwendung. Speziell für PhysikerInnen mit einer Tätigkeit in der Industrie, bietet sich hier die Möglichkeit des wissenschaftlichen Austauschs.

Es spricht:

Prof. Dr. Norbert Kaiser

IOF Fraunhofer Institut für Angewandte
Optik und Feinmechanik Jena

Über:

***Der hauchdünne Vorsprung:
Optiken für die EUV-Lithografie***

Die Diskussion leitet:

Dr. Roman Leitsmann

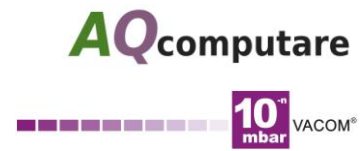
AQcomputare Gesellschaft für
Materialberechnung mbH

Ab 18. 00 Uhr kleine Bewirtung im Foyer und Zeit für Gespräche.

Für die Teilnahme ist eine **Anmeldung** bis zum **13. Mai 2011** erforderlich unter:

<http://www.dpg-physik.de/dpg/gliederung/ak/aiw/>

Prof. Dr. Norbert Kaiser ist seit 1991 Abteilungsleiter "Optische Schichten" und stellvertretender Institutsleiter am Fraunhofer Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik (IOF) in Jena. Er ist Autor international bekannter Arbeiten auf dem Gebiet dünner Schichten für die Optik, Mitherausgeber des Buches „Optical Interference Coatings“, Springer 2003 und Organisator zahlreicher Konferenzen. Herr Prof. Kaiser lehrt an der Fachhochschule Jena Physik und Technologie dünner Schichten sowie Nano-optik.



Zum Inhalt des Vortrags:

Die nächste Generation von Lithografie-Anlagen, die in der Halbleitertechnik zum Drucken der kritischsten Strukturen eingesetzt werden wird, basiert auf dem Einsatz von Extrem-Ultra-Violetter Strahlung mit einer Wellenlänge von 13,5 nm. Damit existiert eine technische Lösung, Strukturgrößen von 16 nm oder kleiner zu fertigen und die bisherige, Laserlicht-basierte DUV-Lithografie bei 193 nm Laserwellenlänge abzulösen. Die in den entsprechenden EUV Lithografie-Clustern eingesetzten Optiken zur Ablenkung und Fokussierung des Strahls müssen höchsten Anforderungen an Qualität und Genauigkeit genügen. Die Reproduzierbarkeit der Schichtdicken muss etwa 10 pm betragen. Zum Vergleich beträgt der Durchmesser des Wasserstoffatoms ungefähr 100 pm. Wie das mit ausgefeilten Beschichtungsmethoden tatsächlich gelingt, ist Inhalt dieses Vortrages.

Bitte nutzen Sie die Parkplätze im gegenüberliegenden Einkaufscenter ACC.